

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成25年5月30日(2013.5.30)

【公開番号】特開2012-232591(P2012-232591A)

【公開日】平成24年11月29日(2012.11.29)

【年通号数】公開・登録公報2012-050

【出願番号】特願2012-149041(P2012-149041)

【国際特許分類】

B 3 2 B	27/00	(2006.01)
B 3 2 B	27/16	(2006.01)
B 0 5 D	7/24	(2006.01)
B 0 5 D	3/04	(2006.01)
C 2 3 C	14/20	(2006.01)

【F I】

B 3 2 B	27/00	1 0 1
B 3 2 B	27/16	
B 0 5 D	7/24	3 0 2 Y
B 0 5 D	3/04	C
C 2 3 C	14/20	B

【手続補正書】

【提出日】平成25年4月12日(2013.4.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリマー基材(10)と、
式 $R_2Si(OR')$ ₂のジオルガノジオルガノオキシシラン、式 $RSi(OR')$ ₃の
オルガノトリオルガノオキシシラン又は両者の部分縮合物を含んでなる第一の層(20)
(式中、Rは独立に炭素原子数約1～3のアルキル基、炭素原子数約6～13の芳香族基
、ビニル基、3,3,3-トリフルオロプロピル基、-グリシドキシプロピル基及び
-メタクリロキシプロピル基からなる群から選択され、R'は独立に炭素原子数約1～8
のアルキル基、炭素原子数約6～20の芳香族基及び水素からなる群から選択される。)と、

プラズマ中で重合及び酸化した有機ケイ素材料を含んでなる第二の層(30)であって
、ケイ素、酸素、炭素及び水素を含み、過剰の酸素の存在下で 10^6 ～ 10^8 J/Kgのパ
ワーレベルで第一の層の上に堆積した第二の層(30)とを含んでなる多層品。

【請求項2】

ポリマー基材(10)と、

式 $R_2Si(OR')$ ₂のジオルガノジオルガノオキシシラン、式 $RSi(OR')$ ₃の
オルガノトリオルガノオキシシラン又は両者の部分縮合物を含んでなる第一の層(20)
(式中、Rは独立に炭素原子数約1～3のアルキル基、炭素原子数約6～13の芳香族基
、ビニル基、3,3,3-トリフルオロプロピル基、-グリシドキシプロピル基及び
-メタクリロキシプロピル基からなる群から選択され、R'は独立に炭素原子数約1～8
のアルキル基、炭素原子数約6～20の芳香族基及び水素からなる群から選択される。)と、

プラズマ中で重合及び酸化した有機ケイ素材料を含んでなる第二の層(30)であって、ケイ素、酸素、炭素及び水素を含み、第一の層の上に堆積した第二の層(30)とを含んでなる多層品であって、当該多層品がキセノンアークウェザロメータ中ASTM G26サイクルで6875kJ/m²の輻射線照射後に実質的に微小亀裂のない状態に留まる多層品。

【請求項3】

第一の層(20)が紫外線吸収剤をさらに含んでなる請求項1又は2記載の多層品。

【請求項4】

第一の層(20)の厚さが1~15ミクロンである請求項1又は2記載の多層品。

【請求項5】

第二の層(30)の厚さが0.5~5.0ミクロンである請求項1又は2記載の多層品。

【請求項6】

基材(10)と第一の層(20)との間にプライマー層(15)をさらに含んでなる請求項1又は2記載の多層品。

【請求項7】

有機ケイ素材料の単量体が、テトラメチルジシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン及びオクタメチルシクロテトラシロキサンの1以上を含んでなる請求項1又は2記載の多層品。